Searching PAJ Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 03-112683

(43)Date of publication of application: 14.05.1991

(51)Int.Cl. B41M 3/00 B41M 1/34

G02F 1/1343 H01L 29/784

(21)Application number: 01-249014 (71)Applicant: TOPPAN PRINTING CO LTD

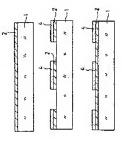
(22)Date of filing: 27.09.1989 (72)Inventor: MOGI MASAO

NAGASE TOSHIRO

(54) PRINTING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent electrification by forming an ink film pattern through performing print by the use of an oilbase ink on an insulating substrate with a conductive high molecular compound film formed on the surface. CONSTITUTION: A conductive high molecular compound film 2 is formed on an insulating substrate 1 and print is performed by the use of an oil-base ink to form an ink layer 4 pattern on an insulating substrate 1 with the conductive high molecular compound film 2 formed on the surface. As materials for the conductive high molecular compound film 2 to be used, poly-(3-alkyl-2,5-thienylene), poly(3-alkoxyl)thiophene, etc., are suitable. The conductive high molecular compound film 2 is formed on the insulating substrate 1 and print is



performed on the film so that a thin film 4 of ink is formed in the manner of corresponding to the printed pattern. An electrostatic charge generated in the thin film 4 of ink is discharged via the conductive high molecular film 2 forming the substrate for the electrostatic charge so that a charge-up phenomenon can be prevented. As desired, the conductive high molecular film 2 remaining in a region, where no print is performed, is removed by dissolution in an organic solvent.

Searching PAJ Page 2 of 2

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本 图 特 許 庁 (JP)

@ 辨許出顯公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-112683

@Int. Cl. 5 B 41 M 庁内築理番号 7029-2H

厳別記号

❸公開 平成3年(1991)5月14日

H 01 L 29/78 3 1 1 海脊請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

の発明の名称 印刷方法

1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲

の限 (2) を形成し、

ターンを形成する

笈薄電性高分子化合物の腰(2)が表曜に形成

されている務机絶縁性茶班(1)に、抽色インタ

を使用して印刷をなして、インク膜(4)のパ

(2) 前記導電性高分子化合助の職(2) は、ボ

リー(3~アルキルー2.5~チェニシン)、ポ

リ (3-チオフェン~8-エタンデルフォネー

よ)、より(3ーペキシル)チオフェン、ボリ

(3-オクチル) チオフェン、ポリ (3-オクタ

デシル) チオフェン、及び、ポラ (3~アルコシ

ル)チオフェンからなる群から選択することを特

[3] 総経性基板(i) 上に非常性異面活性器の

散とする確求項(1)記載の毎副方法:

工程を有することを特徴とする印刷方法。

印新方法

@特 剪 平1-249014 題 平1(1989)9月27日

危殺 明 岩 茂 木 雅具 實京都台東区台實1丁目5番1冊 凸版印刷株式会社内 危発 明 者 長 瀬 俊郎 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内 ⑪出 颐 人 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東1丁目5番1号

(70代: 班 人 弁理士 寒川 減一

誰(3)を形成し、

協議電性界面指性剤の額(3)が表摘に形成さ れている絶縁性基徴(1)に、胎性インクを使用 して即動をなして、インク環(4)のパターンを (1) 総縁性萎恢(1)上に導電性高分子化合物 窓位する

工程を有することを特徴とする印刷方法。

[4] 维绍基督特易斯茨特制の路(3) は、高袋 アルコールの酸化エチレン付加体の硫酸エステル 塩、アルキルフェノールの酸化エチレン付加体の 短脚エスチル海、リン酸糖液化である器器でル コールの酸化エチシン付加性のリン酸エステル塩、 アルキルフェノールの酸化エチレン付加体のリン 盤エステル塩、1ーオクタデシルーちメチルビス グアエド塩酸塩、ヘブタデシルイミダゾリン、2 ーグアニジン・ペンズィミグゾール、N-モノア セチルエチレンジアミン、L-7スパラギン酸ジ

ブチルスステル、アルキルトリメチルアンモニウ ム塩、及び、N-アルキル4級アンモニウム塩か らなる群から選択することを特徴とする請求項

(3) 記載の時別方法。

-473 -

特別平3-112683(2)

3. 発明の詳報な疑問

[産業上の利用分野]

本塾明は印刷方法の改良に関する。特に、ガラ ス等運営の絶縁効上になず抑制方法の改造に関す る。さらに終しくは、強額トランジスタ(以下で PTと云う。) 等を制造する工程に使用され、前 性インタ(絶縁性インタ)の独国等をもって構成 されるエッチングマスク等を製造する工程に使用 されるに好適にすることを目的としてなした印刷 方粒の改良に関する。

(従来の技術)

ゴム等の維持物よりなるブランケット表面に逝 択的にパターン状に付着した印刷用インクを、紙 等の維維性被膜に転写してなず印刷方法において、 紙等の絶縁性被膜とゴム等の絶縁物よりなるブラ ンケットとの摩婆等にもとづき、これら(紙等の 追線性接限と蜘蛛性プランケット) の間に移電機 が蓄積し、これらの間の電位差が、部分的には、 1,03 (V以上に進して、これらの間で放電する

ことがあり、そのため、印刷して影視されたイン タ層や紙等の被除が破損することがあると云う欠 当がラブ切られている。

このいわゆるチャージアップ理念を助止するた めに、経来、下記する親々な手段が講覧され、実

イ、インクに雰囲洒性剤等の無電物止剤を混入し ておいてインクを導電性として、インク被撲に着 常した健康を折奪する.

ロ、その上に印刷がなされる紙幣に昇面洛佐剤等 の帯電防止前を進入しておいて紙等を蒸電性とし て、転等に非難した健康を放棄する。

ハ、その上に印刷がなされる紙等に速度を与えて おいて、祇猫に帯電した電荷を放電する、 ニ,スタリーン即別法においては、妙をステンレ

スやカーボン等の厚電材を使用して製造し、導電

カ、オフセット印刷値においては、ブランケット を芽草性とする。

つ、推測り部別法においては、会議を設けを使用

する、

ト、その上に印刷がなされる差材が低以外である ときは、真空複雑物等を検用してその基材の年に 金銭駿を形成しておく *の手段である。

[発明が解決しようとする課題]

その上に印刷がなされる材料が地積物であり、 植性インタ (機様性インタ)を使用して、その上 に印刷すると、チャージアップが当然に発生する 村料であっても、概等の教質材料である場合は、 上流のように、対応する予覧が積々開発されてい るが、その上に印刷がなまれる材料がガラス等臭 好な跳縁物であると、能来技術において知られて いる上記ィーへのいづれの帯電防止法も有効に程 抱せず、また、トの方法は有効ではあるが、印刷 **完了後に、金属膜を除去する工程が必要となり、** 特に、TPT等を製造する工程に使用するには、 金属隣を除去するために撤洗い等の工程が必要で あるため、適切な方法とは云い何い。

そこで、ガラス等の理警絶議物に対してなす町 刺法、物に、TFT等を製造する工場に使用され、 抽性インクの被談等をもって構成されるエッチン グマスタ等を製造する工程等に使用される研制法 において、夢電が助止されている印刷方法を提供 することなある。

(課題を解決するための手段)

上記の目的は、下記いづれの手数によっても連 成される。

第1の手段は、鉋縁性蓋板(1)上に導電性高 分子化会物の際(2)を形成し、この課業性高分 子化合物の頭(2)が表面に形成されている組縁 独基板 (1)に、抽発インクを使用して印刷をな してインク腺(4)のパターンを形成する工程を 存する印刷方法である。

この第1の事数に使用される導電性差分子化合 物の膜(2)の材料としては、ポリー(3ーナル キルー2、5ーチェニレン)、ポリ(3ーチギ フェンーターエタンデルフェネート)、ポリ〔3

持期平3-112683(3)

ーヘキシル) チオフェン、ポリ (3 - オタチル) チオフェン、ポリ (3 - オタタギシル) チオフェ ン、ポリ (3 - アルコシル) チオフェン等が好選 である。

これらの専電技術分子化合物は、選索の育製特別、例えば、タロロホル人、ジクロロックン、トルエン、ナトラハイドロフラン等に開展するので、これらの存储資料に関係して、この限量をスピンコートできか、その上に即制がなされる超純地等 ((1) まこの修復申に提通すればよい。 別2の今後は、機能性基度(1) 上に事電性界

頭20 中央は、機能性基限(1)上に海電電路 原治性用の酸(3) を形成し、この電電性展面的 性別の頭(3) が表質に形成されている機能性基 級(1)に、物性インクを使用して印刷をなして インク酸(4)のパターンを形成する印刷が始せ ある。

この第2の手段に使用される得電性非関密性期 の酸(3)の材料としては、アニオン性としては、 促縦誘導体である高級アルコールの限化エチレン 付加体の被数エステル塩、アルキルフェノールの

の上に削削がなわて、向前パターンに対応して、イックの確議を分所であることになるので、このインタの経験は仁発生する神程度はその下面の またいは単性性所の活性制限 3を分化と放電され、その上の回側がなられなかった 摂植に対策した大産性高分子形をまたは基準性所 語言性無限 3 次、所望により、その後、没有は有 政庁ればいり、

[実施例]

以下、回顧を参照して、本発明の二つの実施資 についてさらに説明する。

<u>第1 実施</u>数 (専電性高分子機を使用する例) 素1 図 (a) 参照

原さが約(血であり、その表際模が約100 cd であるガラス版(上に、スピンコート法を使用し で事電性高分子化合物の代表例であるボリー(3 報化エチレン付款はの複数エスチル場や、リン検 標準はである高数アルコールの例化エチレン付款 体のリン酸エステル場、アルモルフェノールの例 なエチレン付款をのリン酸エストル場を外に着で あり、カテオン性としては、3 - オクラナシルー 5メテルビスグランド温機能、ペプラナシルイミ メリン、2 - マフェジン・エスモダゲール Nーモノフモデルエチレングフミン、しーフスパ カーボンタン・エスエグル、フルキルトリメデル カボ砂点である。 H - フルキルトリメデル 気が終れてある。 H - フルキルトリメデル 気が終れてある。 H - フルキルトリメデル 気が終れてある。 H - フルキルトリメデル 気が終れてある。

これもの爆電性界価値性別は水均性であるから、 水に暗解し、その溶液をスピンコートするか、そ の上に印刷がなされる絶縁性高級(1)をこの熔 適中に透慢すればよい。

(作用)

本発明に集る印刷方位においては、ガラス等の 総縁性基級1上に揮電性高分子化合物の膜2また は導性性再顕数性所の機3が形成されており、そ

ープルキルー2,5ーチェニレン)のジタロロメ タン存機をスピンコートして、2m厚の厚電性高 分子化合物の膜21を形成する。

第1回(6)参照

上記のガラス度1を、導電性高分子化会物の代 数額であるまり (3-アルキルー2、5ーチェ エレン)のジタロロメタン溶液中に浸透して、セ の企制に約2m配の原性性高分子化会勢の膜22を 最低してもよい。

第2四条冠

時制機に転払車担重をテーて00℃に処型期 無を使用し、原には下入下能求中期を使用し、イ 少をは物性インク(資料・2)を制力物製品名 ドDレジスト)を使用し、上記の基度性高分子化 合物の数をサモの上に加減されているサベラ・根1 上に、油性インク(ドロレジスト)のパターンよ を時期が表する。

新聞平3+112G83(4)

クーン4の下絶は毒魔性分子化会物の限まである から、これを介して放電するので、何の不能会も からない。

米国とュール・エレクトロエクス社会数量研定 機ESCA203型を使用して制定したところ、 30V以下であった。なお、参考のため、解処理の 場合も前定したよころ、最大4,090 Yであった。 第2間参数

パターンインクが乾燥した後、所頭によっては、 上紀の有機溶解を後閉して、インクパターン4の 形成されなかった構成から、遅程性高分子化会物 の第2を始まする。

以上の工程をもって形成されたインクパターン はは、微光用マスタ・エッチング様マスタとして 使用しうる他、イングを通知に選択されば、絶縁 限としても使用しうる。

原2度短例(厚葉性界断張性形を使用する例)

第1週 (c) 参照 原さが約300 ptであり、その表面積が約50

ン4 には、静電前が発生するが、このインタバ ターン4 の下途は再電性再関値性指の限3である から、これを介して数電するので、何の不都合も からないたか。

米国ヒュール・エレクトロエクス社製料電測定 装さるCA2の3型を使用して制度したところ、 50 V以下であった。なお、参考のため、無熱度の 場合も限定したところ、量大4,600 Vであった。 等5 図書館

パターンインクが乾燥した後、所望によっては、 水を使用して、インクパターンもの形成されな かった情域から、再業特等値派性制の膜3を嫌去 する。

以上の工程をもって形成されたインクパターン はは、程光用マスク・エッチング用マスクとして 使用しうる他、インクを推切に選択すれば、絶縁 取としても検索しうる。

(発明の効果)

以上説明せるとおり、本祭明に係る印刷方法に

はであるガラス版 ! 上に、スピンコート性を被用 して再型性解製物性期の代表例である! ーオクク デンルーラメテルビスグアニド連般語の水保接を スピンコートして、2 μ 深の再電性浮技活性制の 接対を形成する。 実生図 () 也顕

上記のガラス後1を、準電性角階値的所の代表 何である1-オタタデシルーるノチルビスグアユ ド電階塩の水溶液中に投資して、その金面に約2 水深の展電性発電溶性割の膜辺を形成してもよい。 第4回線 第4回線

ロ副標本は紅半社割コクター600CL数印刷 無を使用し、原にはTAFの総式子類を提供し、イ ソクには収益インク(東洋イン+収済機製原品な 9Dレウスト)を使用し、上日の身電物方面を 期の膜3がその上に深刻されているパラス版1上 に、機能インタ(FDレジスト)のパターンもを 開発機工する。

この印刷工程において、上記のガラス板 i 上に 形成された消性インタ(『Dレジスト)のパテー

おいては、その上に助削がなされる単独智恵は、 は、項電性器を形成した依仰的がなされるので、 印質はに発金する材を指数では上記る運動機能をかして で簡電され、インの数等に、計電筒が通道に当内 することはなく、整電によい、 よりなことはない。 4、回路の無な数別

4、四海の耐却な説明第1回(a)(b)は、本発明の第1実施例に係る印刷方法の重電性度(準常性高分子化合物の限)

第1回(s)(d)は、本発界の第2 実施的に係る印刷方法の基準程度(非電性界海話性射線)を 形成する工程を集す例である。

を形成する工程を示す図である。

第2回は、本発明の第1実施製に張る印刷方法の 印刷工程完了後の基項影楽図である。

第3 磁は、本発明の第1 寅詢例に県る印刷方法を 実践した後、篠電性限 (鼻電性高分子化合物説) を数金した後の落板新闻師である。

第4回は、本義明の第2実施例に係る印刷方法の 印刷工程定了後の基板新田園である。

特限平3-112683(5) 第3間は、本発明の第2簿施例に係る印刷方法を 実施した後、単電性膜(鍵電性界頭活性射膜)を 熱去した後の基模顕幽図である。 1・・・塩鞣性基板(ガラス板)、 2・・・導電性高分子化合物の数、 21・・・絶縁性基模(ガラス版)1の1面に形成 された寒電性高分子化合物の際、 22、・・推構性整板(ガラス板)1の金面に形成 された導電性商分子能合物の膜、 3 ・・・ 爆電性界面操性剤の膜、 81・・・絶縁性極极(ガラス板)1の1面に形成 された再覧性野面質性別の様、 32・・・雑雑性養板(ガラス根)1の金面に形成 された導電性界面低性剤の額、 4 . . . 4 7 6 18 9 - 7. 代理人 弁理士 療用禁一

